

6セルリングのM実験室への設置シミュレーション

Y. Arimoto

Osaka University, 1-1, Machikaneyama, Toyonaka, Osaka, Japan

平成 19 年 7 月 18 日

概要

6セルリングのM実験室への設置を3次元CADでシミュレートしてみた。

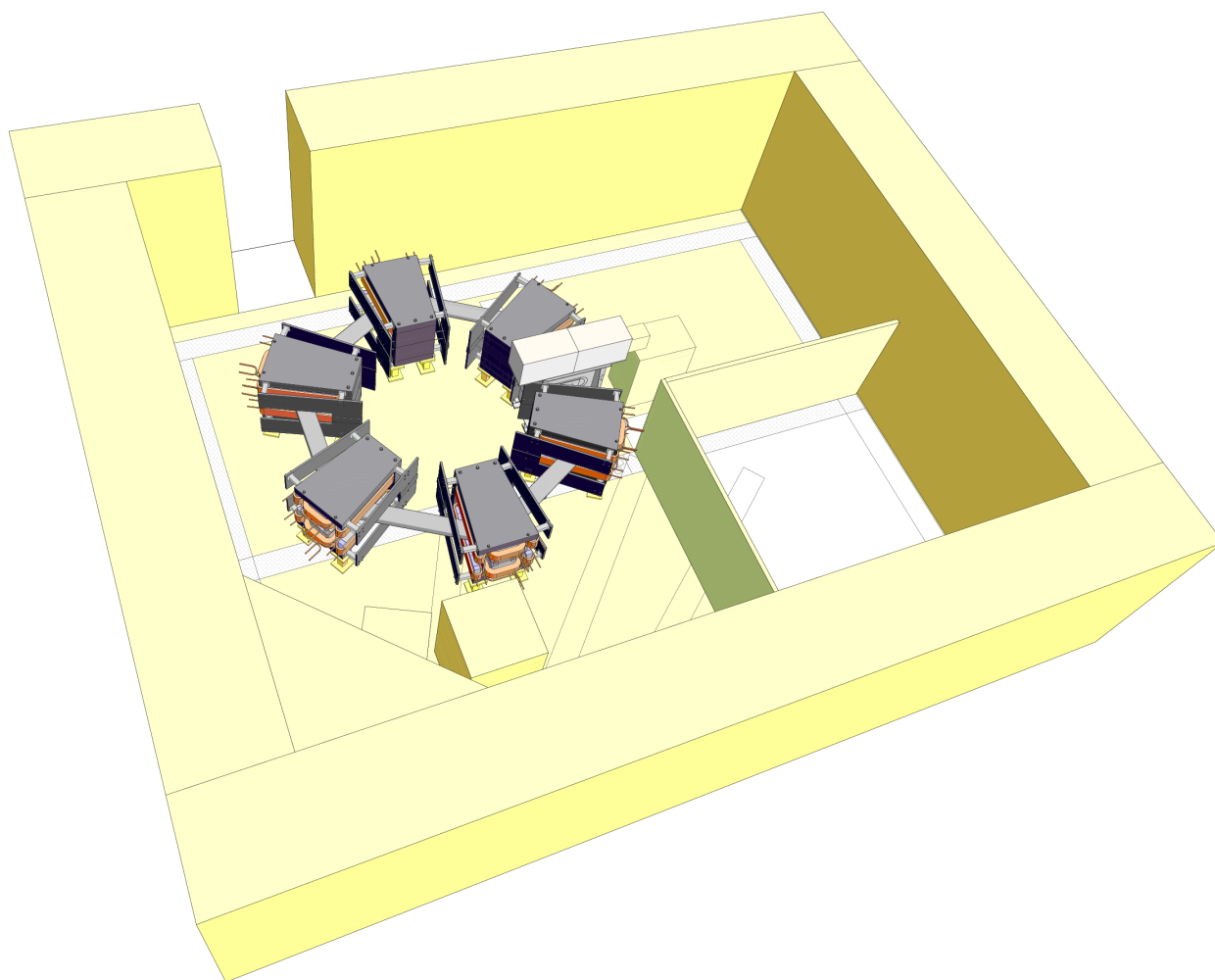


図 1: 6セルリングを設置した M 実験室の鳥瞰図。

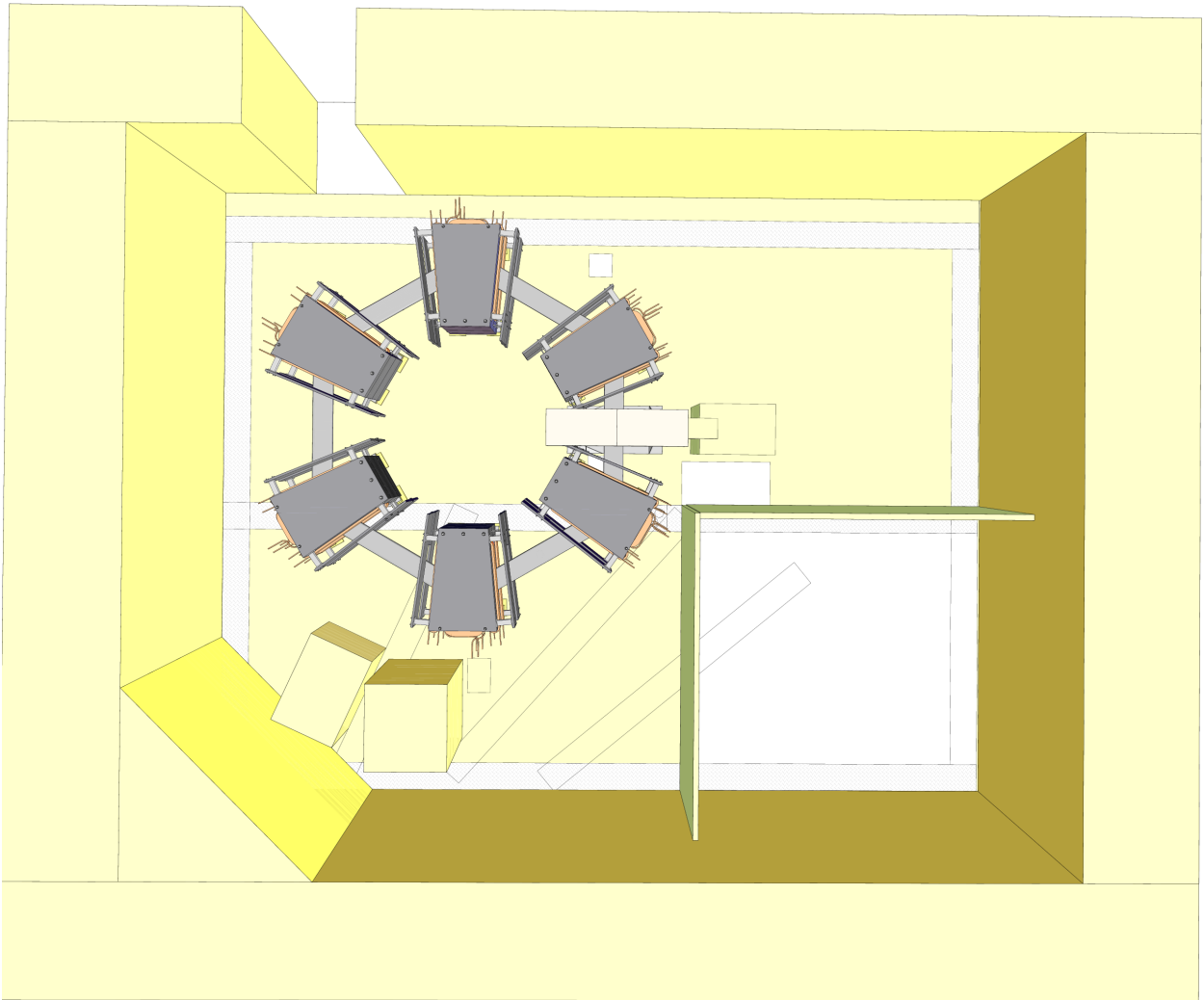


図 2: 6セルリングを設置した M 実験室の鳥瞰図 (ほぼ真上から)。

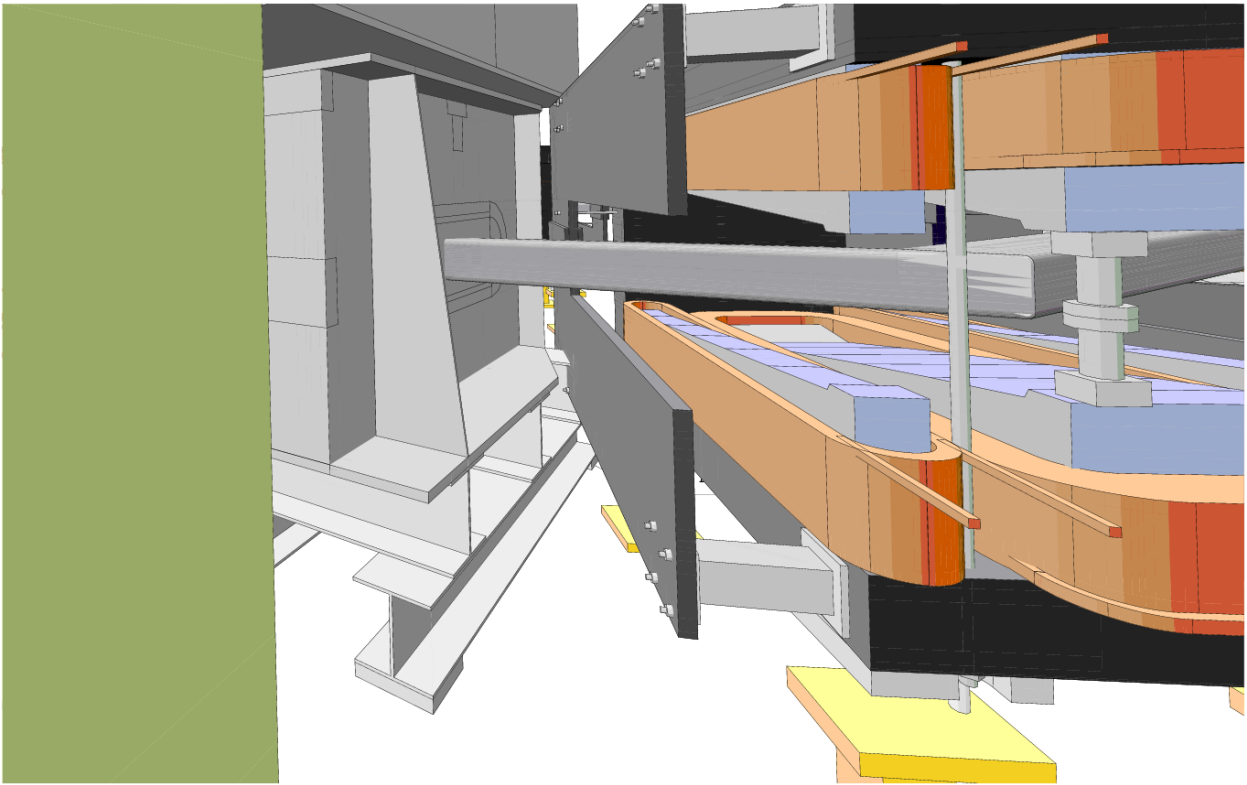


図 3: rf 空洞と電磁石のクランプとの干渉。rf 空洞は干渉しない。架台は干渉している。既に認識しており、改造予定？

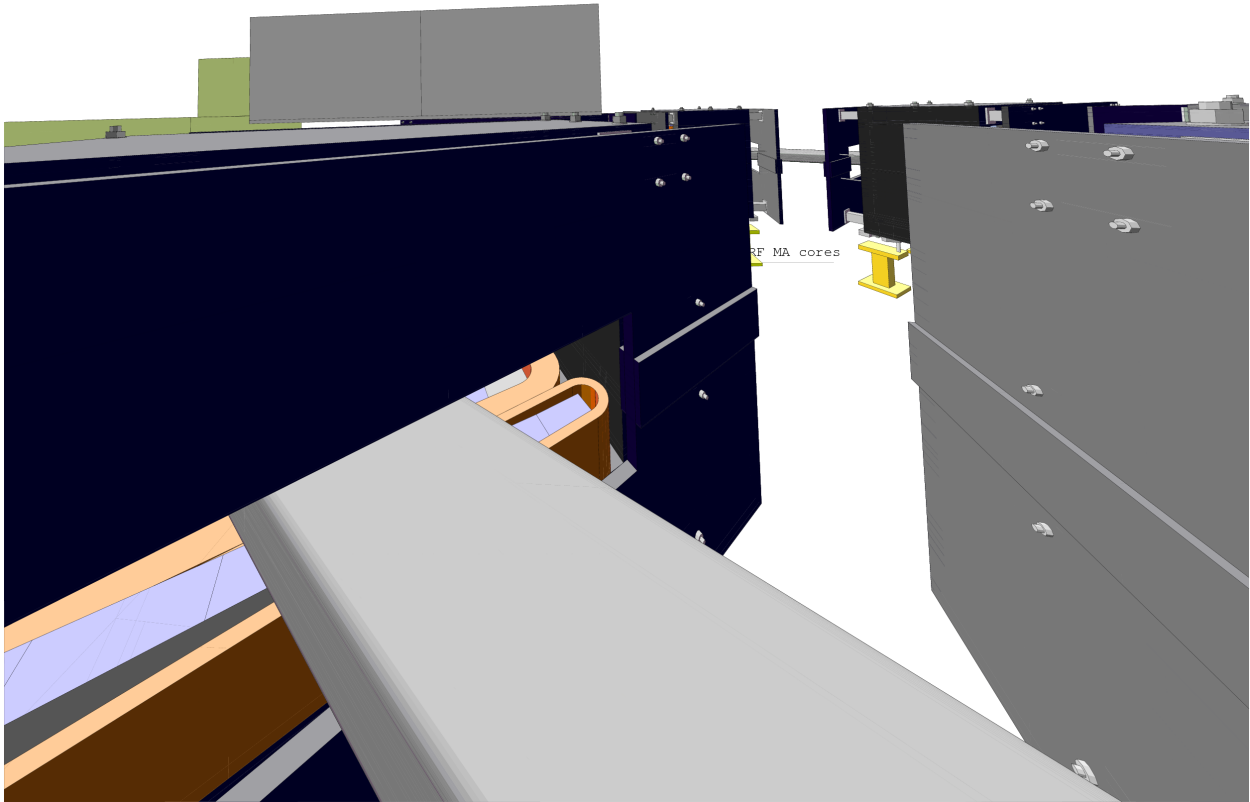


図4: rf増幅器の底面と電磁石のクランプとの干渉。電磁石のクランプ上面の高さは床面から2135 mm。一方、床からrf増幅器の底面までの高さは2160 mm。従って25 mmのクリアランスがある。

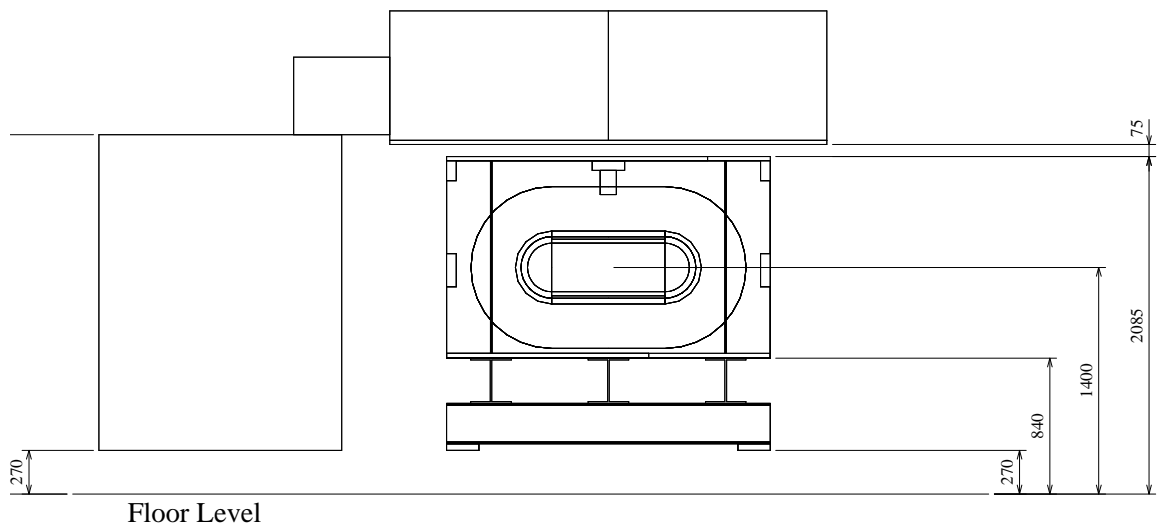


図5: rf空洞正面図。既存の架台だと270 mm高さが不足。

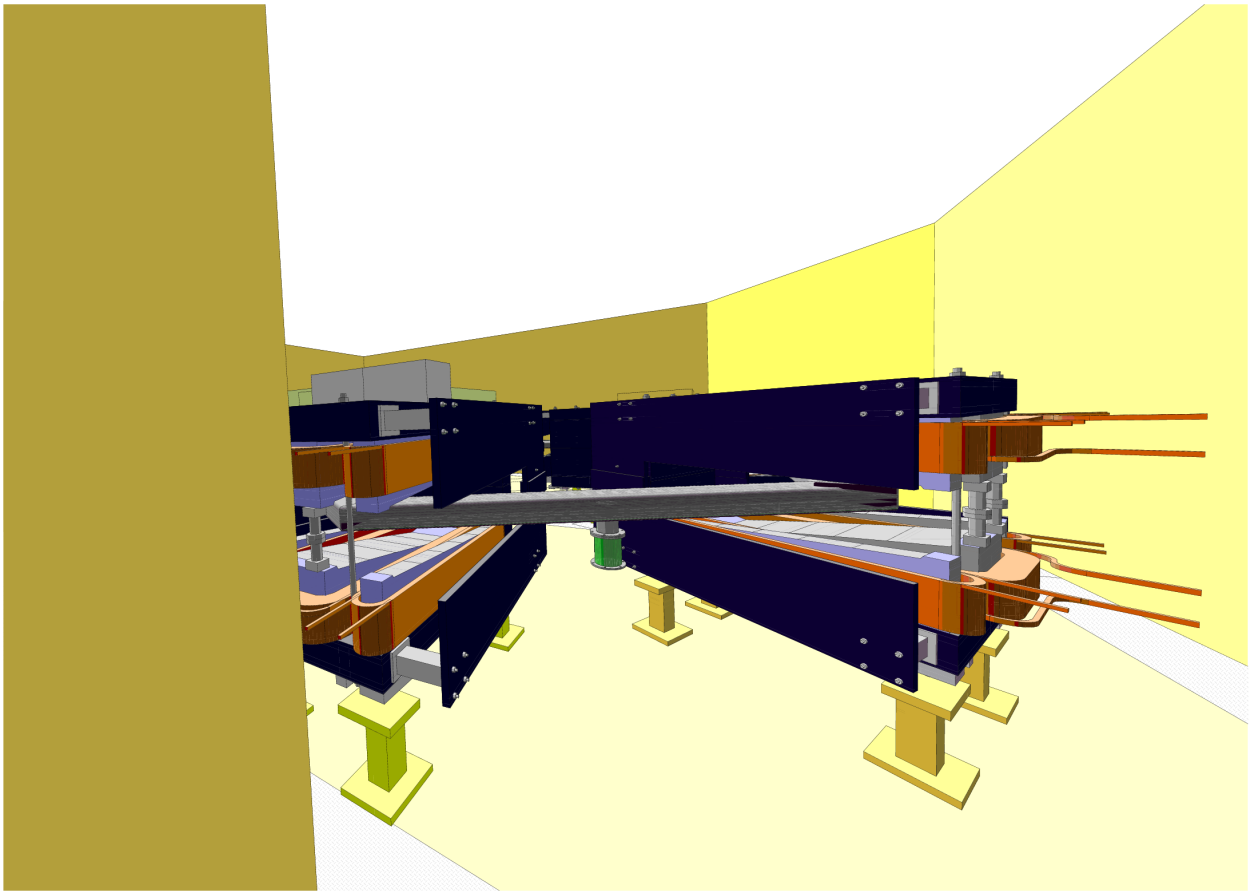


図6: ビームダクトと真空ポンプ。